

先進コーティング技術研究センター講演会

14:00-15:00

“Thin Film Material Development for Our Future Renewable Energy Supply at HZB”

The research activities at the Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), which belongs to the Helmholtz Association of German Research Centers (HGF), for thin film materials for solar cells and photo electrodes for water splitting will be outlined.

Prof. Klaus Ellmer

Helmholtz-Zentrum für
Materialien und Energie,
dept. solar fuels, (Germany)

山本哲也 先生

高知工科大学 大学院工学研究科 教授
総合研究所 マテリアルデザインセンター

本講演では、プラズマダメージを抑えた直流・高周波・高周波重畳直流マグネトロンスパッタリング法やガラス基板上膜厚 10nm 程度で配向性を実現可能とさせる直流アーク放電を用いた反応性プラズマ蒸着法などの特徴を酸化物セラミックス薄膜成長・特性の観点から議論する。加えて、酸化物セラミックス薄膜における酸素欠損を制御可能とさせるべく、新規に研究開発を産学連携で実施した酸素負イオン生成・照射技術の紹介を行い、その効果・課題について議論する。

“酸化物セラミックス薄膜における低温成長戦略と機能制御のための酸素負イオン生成・照射技術”

15:15-16:15

産総研・コーティングアライアンス(JFCA/AIST)
セラミック協会:セラミックスコーティング研究体共催

2017年5月18日(木)
中央5-2棟 第3会議室
6階 6602室

14:00-16:15 講演会

16:15 フリーディスカッション

17:00 懇親会(参加費 3000円 当日払い)

問い合わせ:
先進コーティング技術研究センター
act-webmaster-ml@aist.go.jp